

# 株式会社 トリケミカル研究所

## 第42期(2020年1月期)

### 第2四半期決算説明資料

東京証券取引所  
証券コード:4369

2019.9.5

# 1. 2020年1月期第2四半期決算実績

## 2020年1月期第2四半期連結業績の概要(総括)

単位:百万円

	20.1期 上期実績	20.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 19.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	4,152	4,220	98.4%	3,800	352	9.3%
営業利益	1,153	1,020	113.1%	1,042	111	10.7%
経常利益	1,777	1,390	127.9%	1,155	622	53.9%
当期純利益	1,378	1,040	132.6%	836	541	64.8%

- ！ 計画には若干未達も半期として創業来最高の売上高
- ！ 利益(営業・経常)も半期としては創業来最高を更新
- ！ 韓国関係会社SK Tri Chem等による持分法利益604百万円計上

## 連結貸借対照表

単位:百万円

	(ご参考) 19.1期末	19/7月末	増減額
流動資産	5,437	5,883	446
固定資産	5,657	7,226	1,569
資産合計	11,094	13,110	2,015
流動負債	2,568	3,099	530
固定負債	1,500	2,050	549
負債合計	4,069	5,149	1,080
株主資本	7,068	8,095	1,027
その他包括利益累計額	-42	-134	-91
純資産合計	7,025	7,961	935
負債純資産合計	11,094	13,110	2,015

### 主な増減要因

#### 流動資産

売上債権の増加	202
棚卸資産の増加	147

#### 固定資産

設備投資に伴う有形固定資産の増加	961
持分法利益取込に伴う投資有価証券の増加	509

#### 流動負債

短期借入金増加	450
---------	-----

#### 固定負債

リース債務の増加	642
----------	-----

#### 純資産

当期純利益計上等による利益剰余金の増加	1,027
---------------------	-------

## 連結キャッシュ・フロー

単位:百万円

	(ご参考) 19.1期上期	20.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	554	883
投資活動による キャッシュ・フロー	-987	-747
財務活動による キャッシュ・フロー	536	-85
現金及び現金 同等物の増減額	101	49
現金及び現金同等 物の四半期末残高	1,273	1,644

### 各CFの状況等

#### 営業CF

税前純利益計上	1,777
減価償却費計上	312
持分法による投資利益	-604
法人税等の支払額	-378
売上債権の増加額	-202

#### 投資CF

有形固定資産の取得	-617
無形固定資産の取得	-129

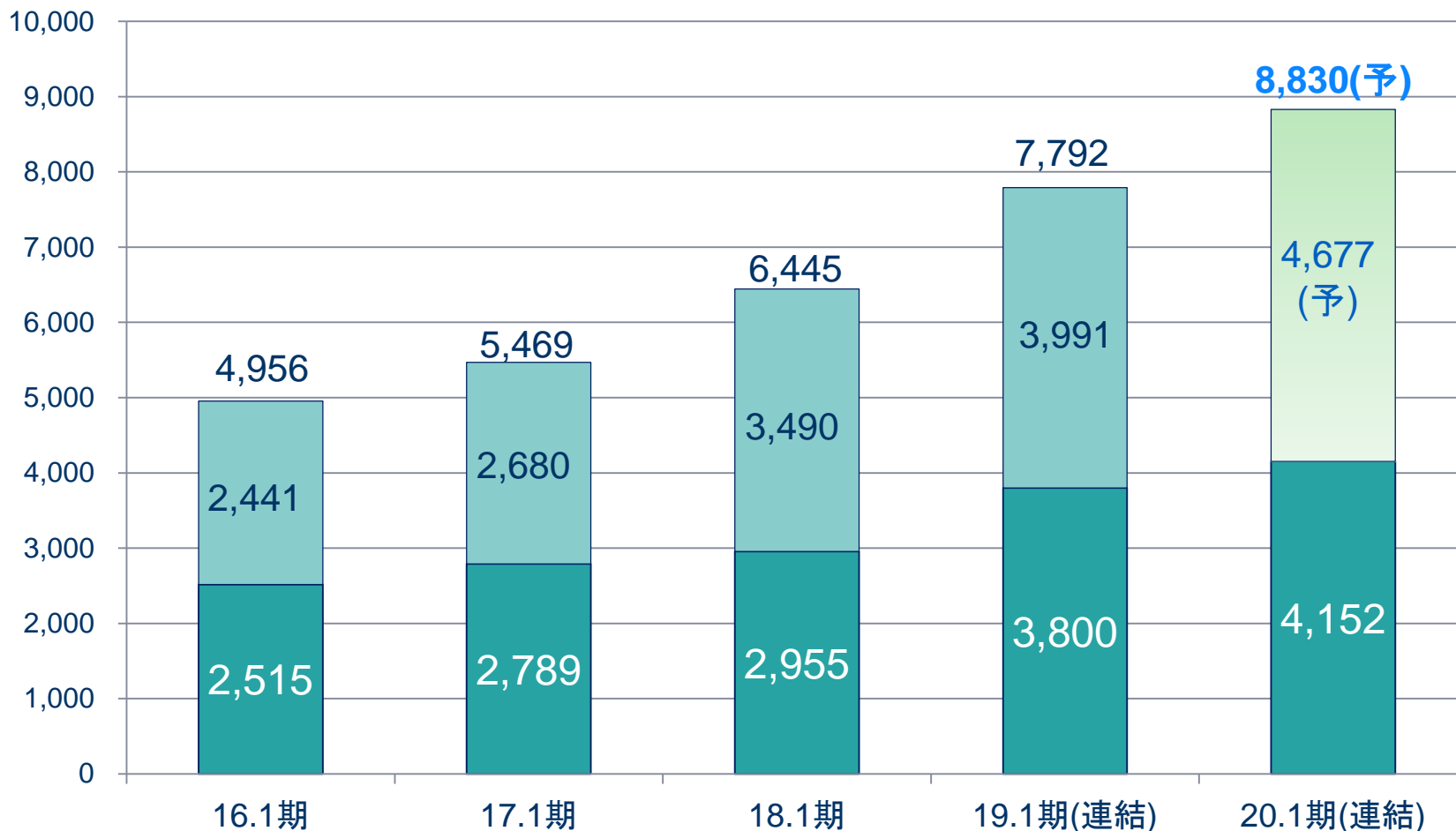
#### 財務CF

借入金調達・返済	299
配当金の支払	-349

## 販売実績

(下部は上期実績)

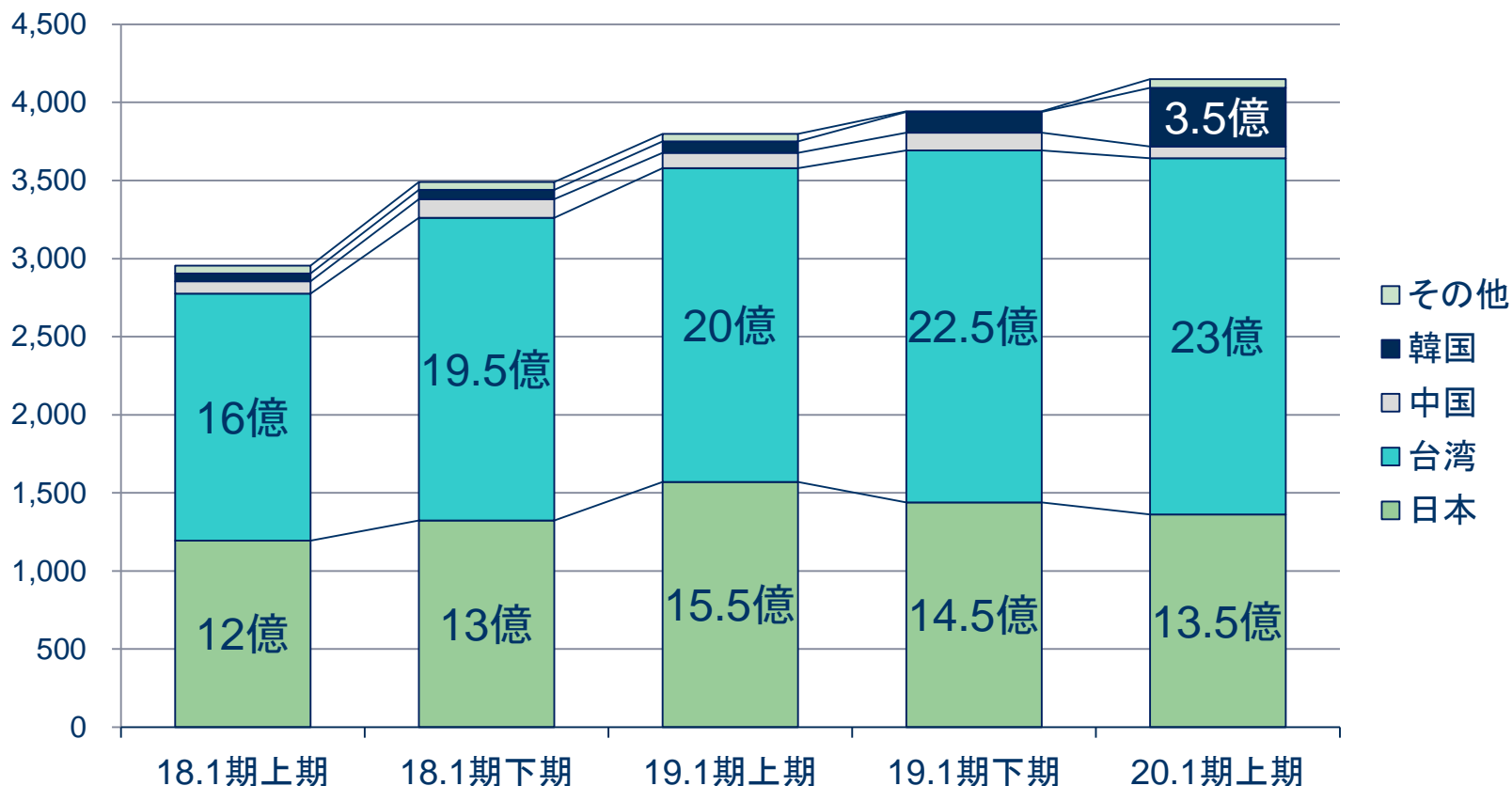
単位:百万円



※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

## 売上分析(ユーザー地域別)

単位: 百万円



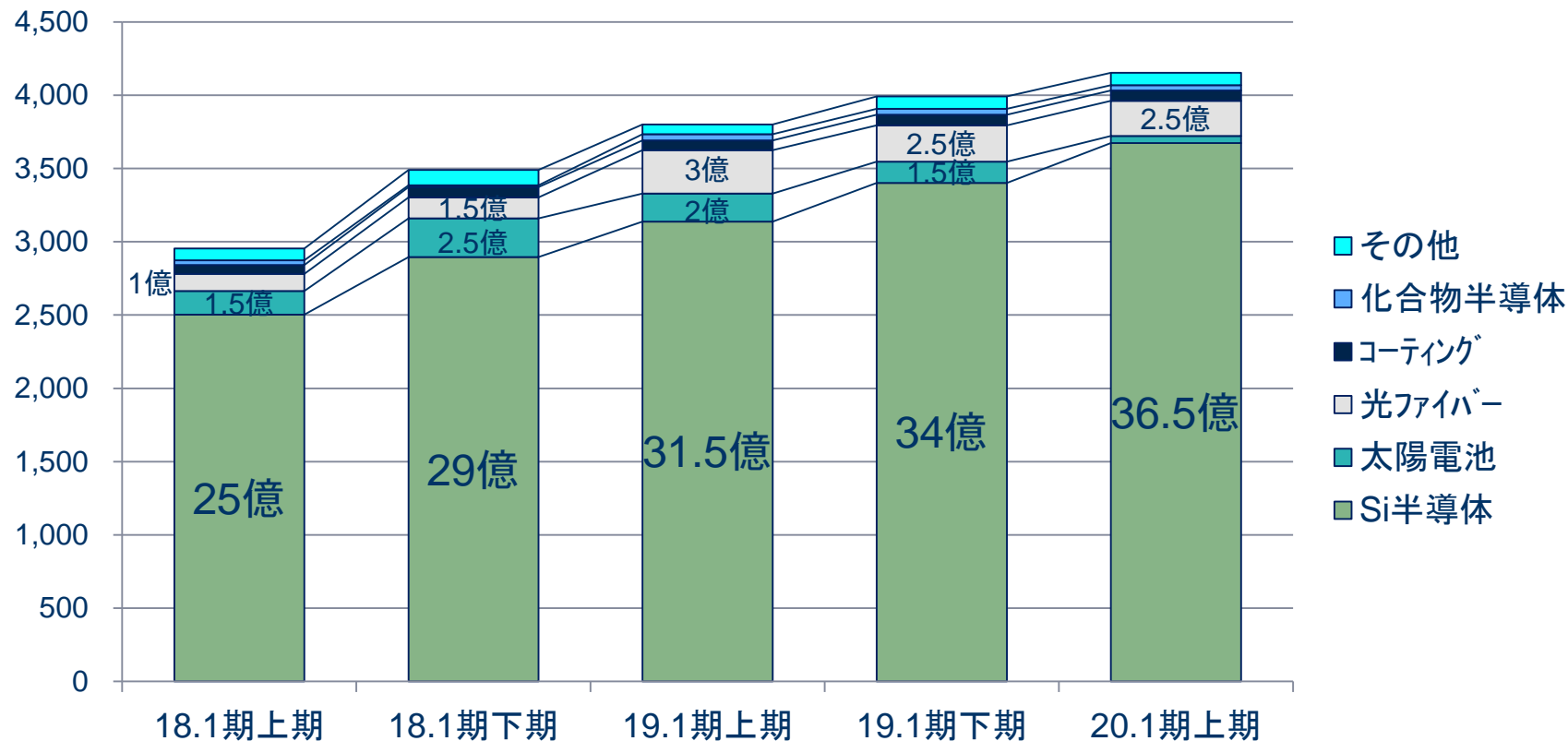
※当社推定による概算値

！韓国向け売上が成長

※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

## 売上分析(製品用途別)

単位: 百万円



※当社推定による概算値

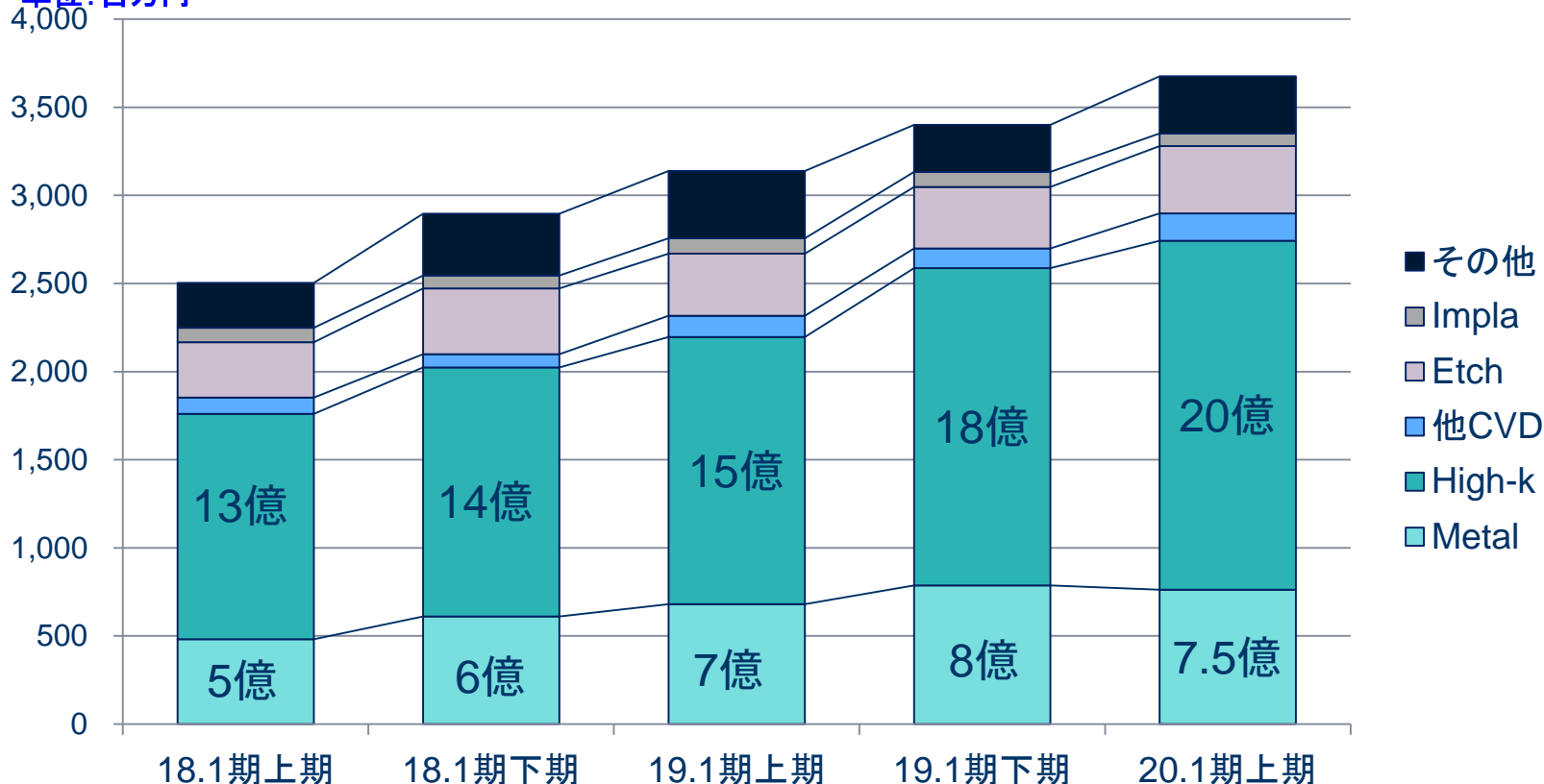
**！ 太陽電池向け材料は大幅減も主力の半導体向けは堅調**

※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。



## 売上分析(Si半導体)

単位: 百万円



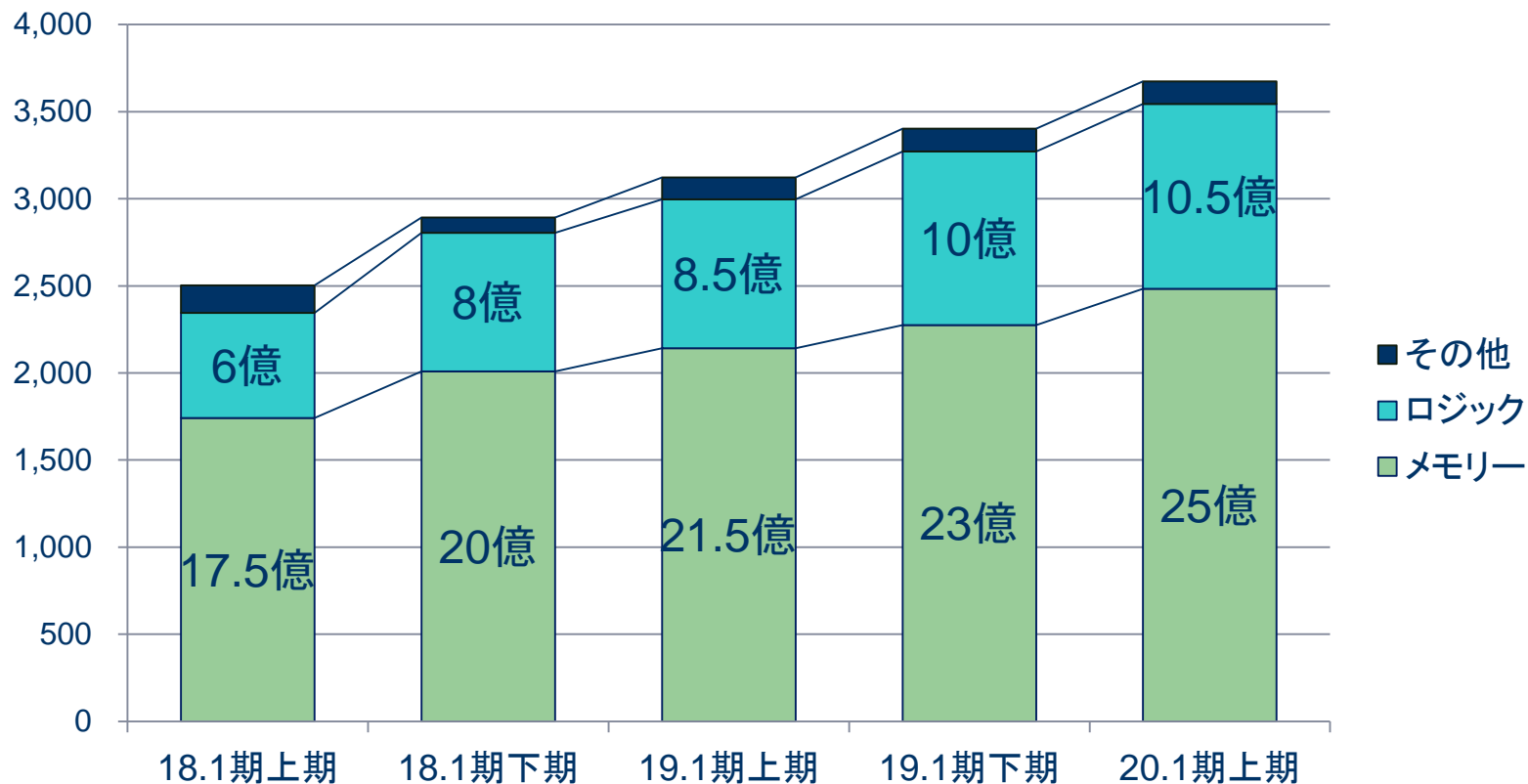
※当社推定による概算値

！ 韓国向けHigh-k材料を中心に堅調に推移

※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

## 売上分析(半導体向け先別)

単位: 百万円



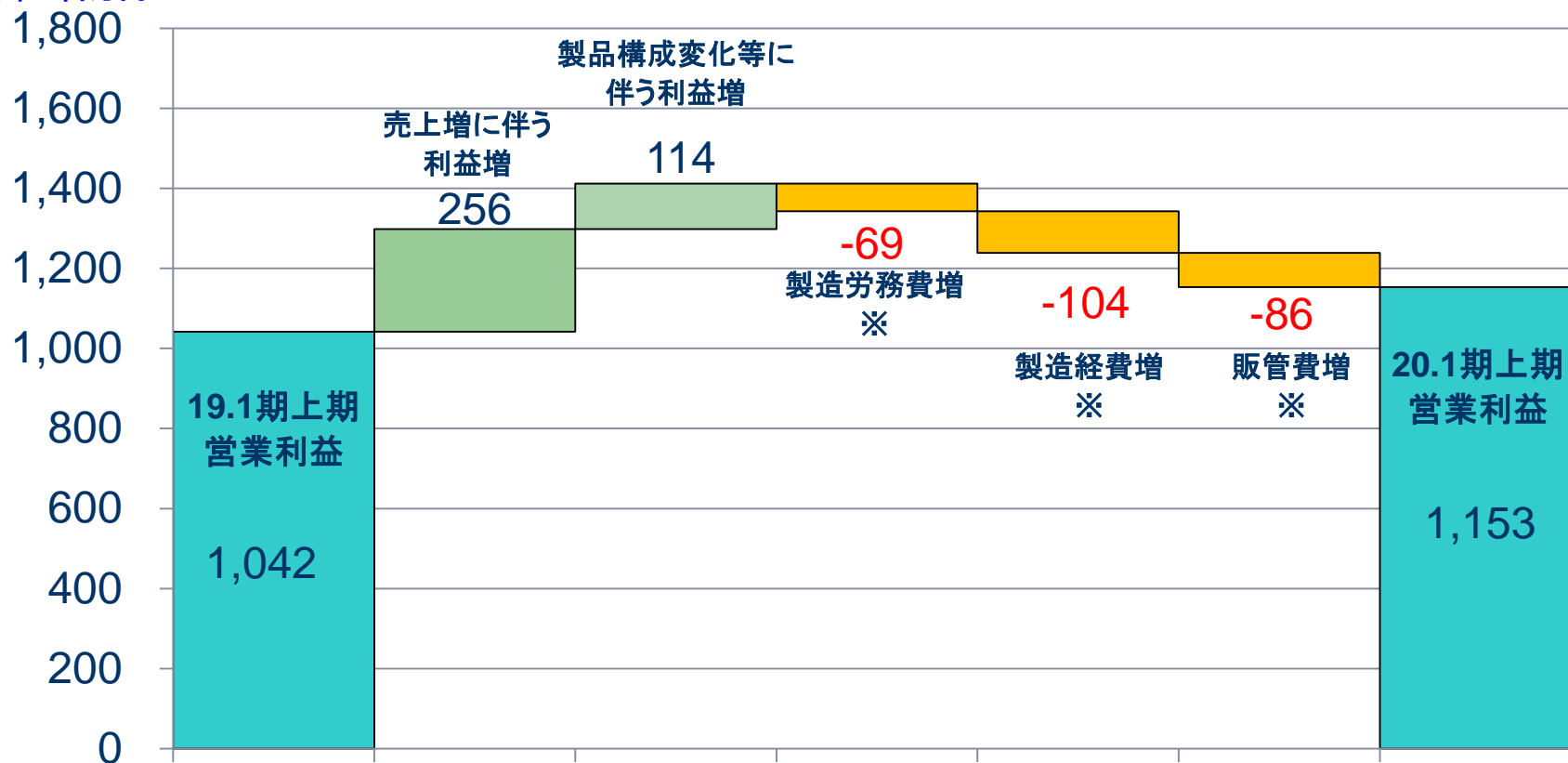
※当社推定による概算値

！メモリー・ロジック向けともに成長を持続

※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

## 2020年1月期営業利益増減要因

単位:百万円



※研究開発費振替前

！新規材料の販売量増加を中心とした売上成長とそれに伴う製品構成改善による利益増

## 2. 2020年1月期通期見通し及び戦略

## 2020年1月期通期見通し

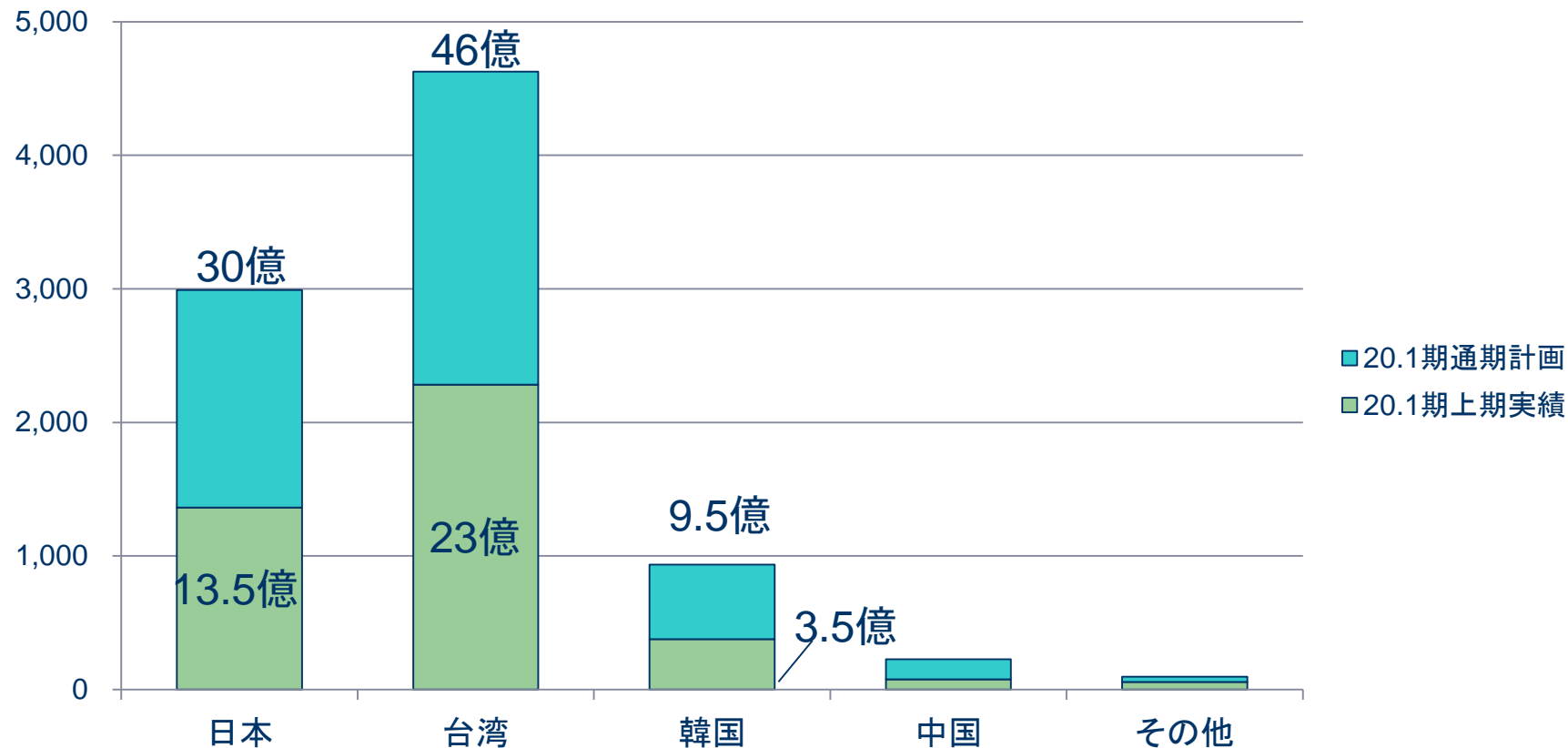
単位：百万円

	20.1期上期	20.1期通期 (計画)	進捗率	(ご参考) 19.1期通期
売上高	4,152	8,830	47.0%	7,792
営業利益	1,153	2,290	50.4%	2,153
経常利益	1,777	3,260	54.5%	2,931
当期純利益	1,378	2,470	55.8%	2,267

**！各利益は順調な進捗**

## 売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

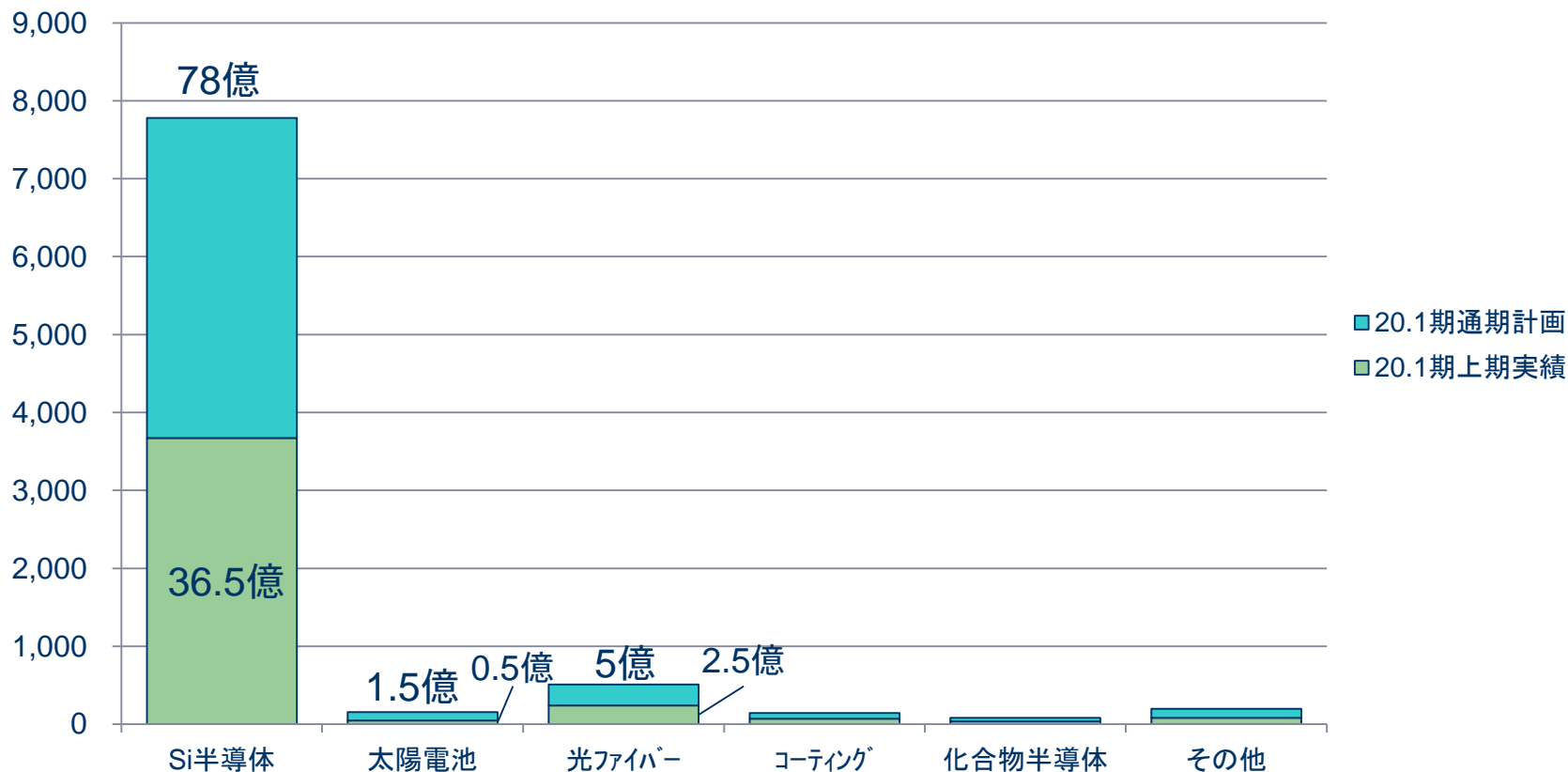


※当社推定による概算値

**！台湾向け売上は好調に推移**

## 売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

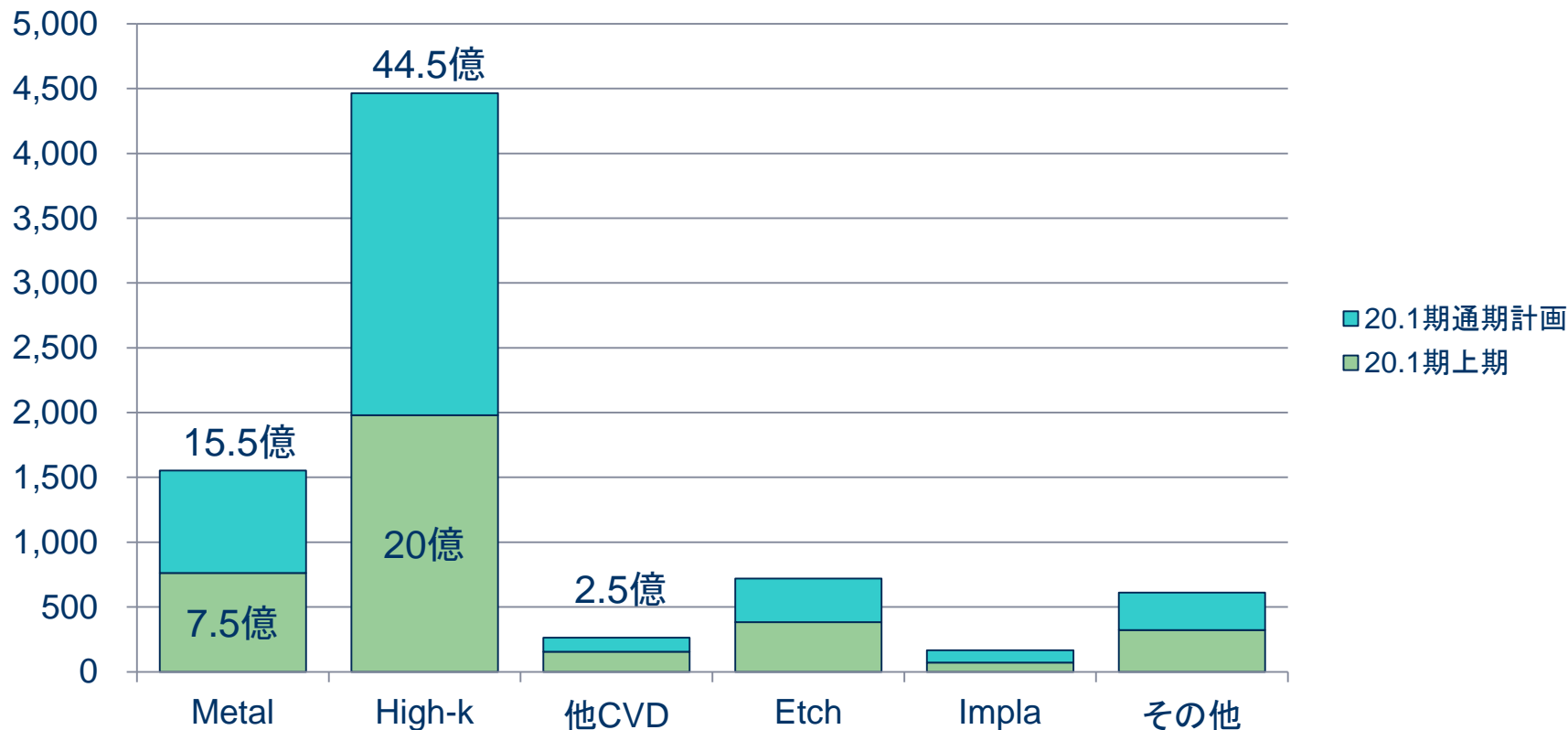


※当社推定による概算値

**！半導体向け材料売上増加が下期の目標**

## 売上進捗分析(Si半導体)

単位: 百万円



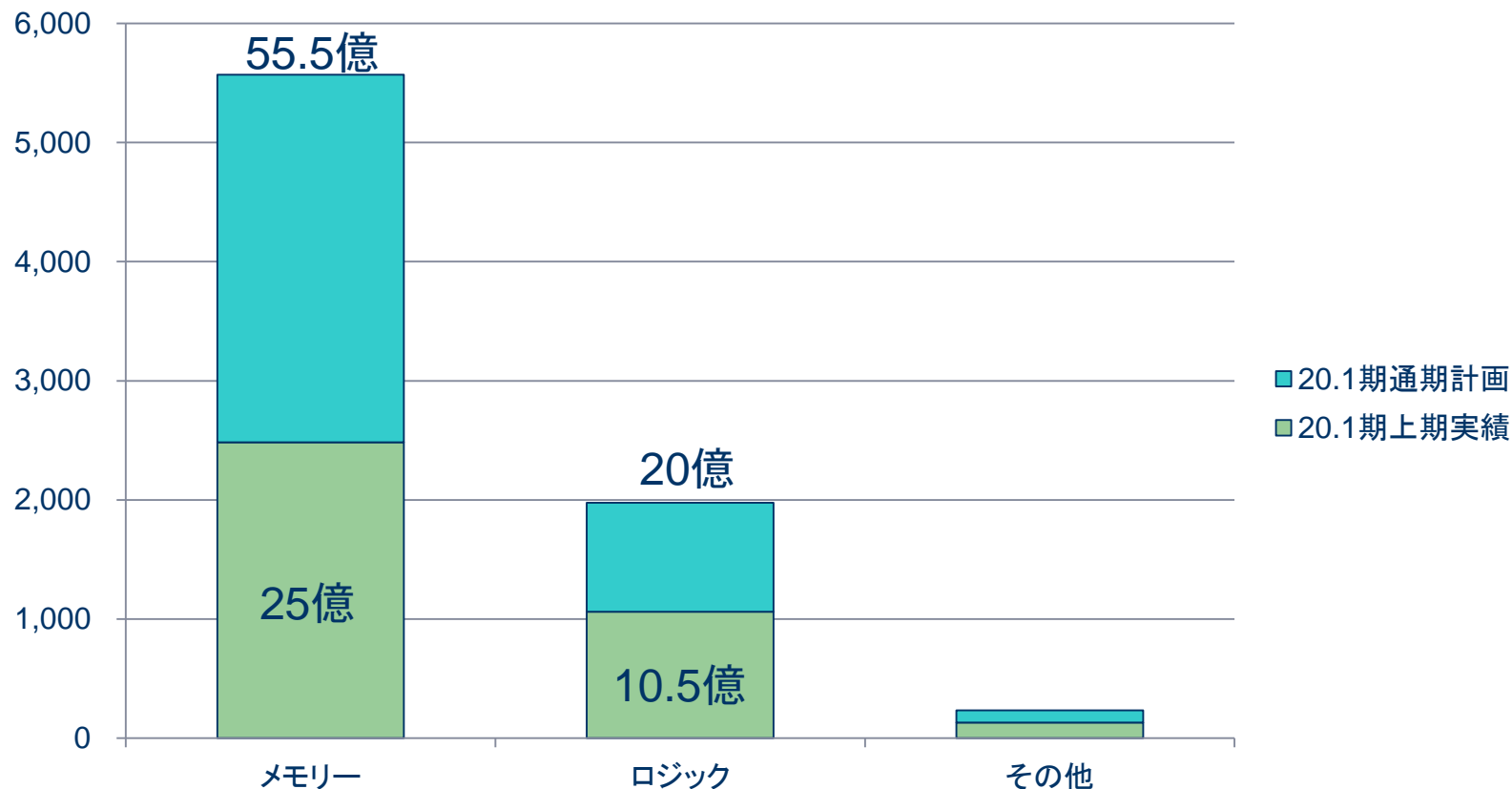
※当社推定による概算値

**! High-k向け材料は更なる成長を目論む**



## 売上進捗分析(半導体向け先別)

単位: 百万円



※当社推定による概算値

**！メモリー向け材料の成長がカギ**

## 2020年1月期下期の見通し

### 外部環境見通しなど

1. 貿易摩擦長期化により半導体市場回復は想定より先送り
2. 光ファイバー市場は堅調に推移
3. 太陽電池材料の回復は当面見込めず
4. 想定レートは\$1=¥107(期初から変更なし)  
感応度は1円で約23百万円
5. 対韓輸出管理規制については現状ではほぼ影響なし

### 下期の施策

1. 韓国JV向け材料の生産体制強化
2. 新規材料(Metal、High-k材料等)の生産性向上継続

### 3. 中期経営計画各施策の進捗について

# 1.台湾子会社新工場建設



来期の竣工に向けて工事は順調



## 2. 第二工場設備投資



High-k、Metal材料製造装置を中心に積極投資を継続

## 3. 安全・品質管理体制の強化

質量とも化学分析能力を向上させるため新棟着工予定

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。  
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先 : [homepageinfo2@trichemical.com](mailto:homepageinfo2@trichemical.com)

## 用語集(Page 9・16)

### Impla

Ion Implantation=イオン注入。半導体に使用されるSi(シリコン)は本来電気を通しにくい物質ですが、ホウ素やリン等のイオンを注入することで、条件によって絶縁性能が変化する「半導体」となります。

### Etch

Etching(エッチング)。ウエハ上に積んだ膜のうち、不要なものを化学反応により削る工程です。

### CVD材料

CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長)法とは、化学材料の蒸気を熱などにより分解しウエハ上に堆積させる技術であり、**CVD材料**とはその際に用いられる化学材料を指します。堆積させる薄い膜は絶縁膜や金属・導体膜・半導体膜であり、使用される材料は多岐にわたっております。

また、半導体の微細化・高性能化を進めるために、従来の製法・材料では解決できない電気的な問題を解決するための誘電率の低い膜が得られる低誘電率層間絶縁膜(Low-k)材料や逆に誘電率の高い膜が得られる高誘電率絶縁膜(**High-k**)材料・物理的な問題を解決するための金属窒化膜(**Metal**)材料などといった新たなニーズに対応するための材料をいち早く提案し、安定供給するのが当社の特徴であります。